## 05;07

# Влияние градиента поля анизотропии на спектры спин-волнового резонанса в пленках ферритов-гранатов

### © А.М. Зюзин, Н.В. Янцен

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск E-mail: zyuzin.am@rambler.ru

#### Поступило в Редакцию 11 марта 2016 г.

Показано, что, в отличие от однородных, в пленках с линейным распределением эффективного поля анизотропии по толщине спектр спин-волнового резонанса состоит из серии высокоинтенсивных спин-волновых (CB) мод и мод с весьма малой интенсивностью. Установлено, что распределение резонансных полей высокоинтенсивных CB-мод зависит от величины градиента эффективного поля анизотропии. При неизменной толщине пленки с увеличением градиента количество таких мод возрастает.

Исследование особенностей спиновой динамики в пленках ферритов-гранатов представляет несомненный научный и практический интерес, связанный с возможностью применения данных материалов в устройствах магнетоэлектроники, спинтроники [1–4] и ряде других.

Известно, что в спектрах спин-волнового резонанса (CBP) двухслойных пленок с однородными слоями или пленок, в которых закрепление спинов обеспечивается поверхностной анизотропией, интенсивность пиков поглощения спин-волновых (CB) мод убывает с номером моды *n* как  $I_n \propto 1/n^2 \div 1/n^4$ . Распределение их резонансных полей подчиняется квадратичному закону  $H_0 - H_n \propto n^2$  [5,6].

Целью настоящей работы являлось исследование зависимости основных характеристик спектров СВР от величины градиента эффективного поля анизотропии grad  $H_k^{eff} = \partial H_k^{eff} / \partial z$  (ось z совпадает с нормалью к пленке).

Исследования проводились на монокристаллических пленках ферритов-гранатов состава (Bi<sub>0.98</sub>Lu<sub>1.9</sub>Gd<sub>0.13</sub>)(Fe<sub>3.54</sub>Ga<sub>1.46</sub>)O<sub>12</sub>, выращенных методом жидкофазной эпитаксии на подложках из гадолиний-галлиевого граната с кристаллографической плоскостью (110). Намагничен-

7

ность насыщения  $4\pi M$  равнялась 107 G, толщина  $h = 2.1 \,\mu$ m, параметр затухания Гильберта  $\alpha = 0.014$ , константа обменного взаимодействия A, которая определялась по температуре Кюри [7], была равна  $1.23 \cdot 10^{-7}$  erg · cm<sup>-1</sup>, гиромагнитное отношение  $\gamma = 1.76 \cdot 10^7$  Oe<sup>-1</sup> · s<sup>-1</sup>. Регистрация спектров CBP производилась на радиоспектрометре PS100.X на частоте 9.34 GHz.

Как показал анализ трансформации спектров СВР, происходящей при послойном стравливании, пленки являлись неоднородными, обладая близким к линейному распределением полей одноосной  $H_{ku}$  и ромбической *H<sub>kr</sub>* компонент анизотропии по их толщине. Такое распределение достигалось плавным изменением температуры раствора в расплаве в процессе эпитаксиального выращивания пленок. Поле  $H_{ku}$  при температуре 20°C изменялось от 340 Ое вблизи подложки до -967 Ое на свободной поверхности, поле  $H_{kr}$  соответственно от 212 до -332 Ое. Значения полей одноосной и ромбической компонент анизотропии и величина grad  $H_k^{eff}$  определялись по резонансным полям нулевой и последней из высокоинтенсивных СВ-мод при ориентации Н вдоль оси [110], совпадающей с нормалью к пленке, а также осей [001] и [110], лежащих в ее плоскости. Кроме того, значения полей анизотропии на поверхности пленки, граничащей с подложкой, определялись также по резонансным полям одиночной линии поглощения тонкого слоя  $(h \approx 0.15 \,\mu\text{m})$  после стравливания верхней части пленки.

В эксперименте величину grad  $H_k^{eff}$  изменяли путем увеличения температуры образца. Поскольку с ростом температуры величина поля анизотропии уменьшается, это обусловливает уменьшение и его градиента. Понятно, что изменение температуры одновременно приводит к уменьшению константы обменного взаимодействия A и намагниченности насыщения  $4\pi M$ . Но, как следует из результатов работы [8], обменная жесткость (отношение 2A/M) изменяется не столь существенно, за исключением области вблизи точки Кюри.

Расчет спектров СВР проводился путем решения волнового уравнения для переменной намагниченности [9]

$$\frac{2A}{M}\frac{\partial^2 m}{\partial z^2} - \left(H + H_k^{eff} - \frac{\omega}{\gamma}\right)m = 0.$$
(1)

Эффективное поле анизотропии  $H_k^{eff}$  учитывало вклад  $H_{ku}$  и  $H_{kr}$  и принималось линейно изменяющимся по толщине пленки

 $H_k^{eff} = B_z + C$ . Расчет показывает, что если  $H_{ku}$  и  $H_{kr}$  линейно изменяются по толщине, то распределения  $H_k^{eff}$ , как и поля однородного резонанса  $H_{ur}$ , по *h* также будут близки к линейным.

С помощью замены переменной уравнение (1) приводили к виду  $\partial^2 m(x)/\partial x^2 - xm(x) = 0$ . Решения данного уравнения находились в виде линейной комбинации функций Эйри, при этом учитывались граничные условия на поверхностях пленки и условие нормировки [9].

Как следует из результатов эксперимента и расчета, проведенных в настоящей работе, в пленках с линейным изменением поля однородного резонанса по их толщине (однородным grad  $H_k^{eff}$ ), зависимость интенсивности пиков возбуждаемых мод от их номера можно разделить на два участка: 1 — участок высокоинтенсивных мод с близкими значениями амплитуд и 2 — участок СВ-мод с весьма малой интенсивностью. Первый участок соответствует возбуждению локализованных мод, для которых существует так называемая "точка поворота" [7,10], в которой волновое число СВ-моды переходит от действительных значений к мнимым. Второй участок соответствует объемным модам, интенсивности пиков поглощения которых примерно на порядок и более меньше интенсивностей пиков первого участка. Нами исследована зависимость спектра высокоинтенсивных СВ-мод от величины градиента эффективного поля анизотропии при ориентациях внешнего постоянного магнитного поля Н вдоль оси одноосной компоненты анизотропии, совпадающей с нормалью к пленке, а также вдоль оси ромбической компоненты, лежащей в ее плоскости.

Спектр СВР при перпендикулярной ориентации **H** относительно пленки и его трансформация, происходящая при изменении величины градиента, приведены на рис. 1. Видно, что спектр состоит из серии пиков поглощения с интенсивностями одного порядка (высокоинтенсивные моды). Начиная с некоторого номера интенсивность пиков резко спадает. С уменьшением величины grad  $H_k^{eff}$  количество высокоинтенсивных мод монотонно уменьшается и при некотором значении спектр трансформируется в единственную линию поглощения. Подобная же трансформация спектра СВР наблюдалась и при ориентации **H** вдоль оси ромбической компоненты анизотропии, лежащей в плоскости пленки.

На рис. 2, *а* приведены экспериментальные зависимости резонансных полей высокоинтенсивных СВ-мод и их количества от величины grad  $H_K^{eff}$  для перпендикулярной ориентации **H** относительно пленки.



**Рис. 1.** Трансформация спектра СВР при изменении grad  $H_k^{eff}$ . Цифры у пиков — номера СВ-мод.

На рис. 2, *b* приведены аналогичные расчетные зависимости. При расчете поле  $H_{ur}$  низкоанизотропной области пленки принималось неизменным и равным  $\omega/\gamma = 3314$  Ое. Видно, что расчетные зависимости согласуются с экспериментальными. Как следует из приведенных результатов, при неизменной толщине пленки с возрастанием гради-



**Рис. 2.** Экспериментальные (a) и расчетные (b) зависимости резонансных полей высокоинтенсивных СВ-мод и их количества от величины grad  $H_k^{eff}$  для перпендикулярной ориентации **Н**. Цифры у кривых — номера СВ-мод.



**Рис. 3.** Распределение точек поворота высокоинтенсивных СВ-мод по толщине пленки (абсцисса) и соответствующих резонансных полей (ордината) при различных значениях grad  $H_k^{eff}$ . Прямые — распределения  $H_{ur}$  по толщине пленки.

ента происходит увеличение количества высокоинтенсивных мод, при этом интервал магнитных полей между ними возрастает. Зависимость разности резонансных полей нулевой и *n*-й CB-мод  $H_0-H_n$  от *n* хорошо аппроксимируется как  $H_0-H_n \propto (n+1/4)^{2/3}$  [9]. Необходимо отметить, что, как следует из полученных нами расчетных и экспериментальных результатов, такая зависимость справедлива только для высокоинтенсивных CB-мод.

На рис. З представлены расчетные результаты по распределению положений точек поворота для высокоинтенсивных СВ-мод по толщине пленки (координате z) и их резонансных полей при различных значениях grad  $H_k^{eff}$ . Видно, что с увеличением grad  $H_k^{eff}$  положения точек поворота смещаются в низкоанизотропную область пленки. Для каждой величины grad  $H_k^{eff}$  существует некоторая толщина (определяемая линией 1), меньше которой в спектре СВР будет возбуждаться лишь одна высокоинтенсивная СВ-мода. Данный вывод подтверждается и результатами эксперимента (рис. 1).

Таким образом, на основе результатов, полученных в работе, можно сделать следующие выводы:

1. Показано, что распределение резонансных полей высокоинтенсивных СВ-мод сильно зависит от величины градиента эффективного поля анизотропии. С его увеличением количество возбуждаемых высокоинтенсивных мод монотонно возрастает. При некоторой толщине пленки, зависящей от градиента, в спектре резонансного поглощения возбуждается лишь одна высокоинтенсивная мода.

2. Ширина спектра — интервал магнитных полей возбуждаемых высокоинтенсивных СВ-мод (или частот при постоянном H) зависит от величины градиента  $H_k^{eff}$  и толщины пленки. Обнаруженная специфика спектров СВР в магнитных пленках с однородным градиентом может представлять интерес для разработки управляемых магнитным полем СВЧ-фильтров на спиновых волнах и других применений.

## Список литературы

- [1] Uchida K., Xiao J., Adachi H. et al. // Nat. Mater. 2010. V. 9. P. 894.
- [2] Kajiwara Y., Harii K., Takahashi S. et al. // Nature. 2010. V. 464. P. 262.
- [3] Schneider T., Serga A.A., Leven B. et al. // Appl. Phys. Lett. 2008. V. 92. N 2.
   P. 022 505(1-3).
- [4] Khitun A., Bao M., Wang K.L. // IEEE Trans. Magn. 2008. V. 44. N 9. P. 2141.
- [5] Зюзин А.М., Сабаев С.Н., Радайкин В.В., Бакулин М.А. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. В. 16. С. 53.
- [6] Зюзин А.М., Бажанов А.Г., Сабаев С.Н., Радайкин В.В. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. В. 4. С. 33.
- [7] Зильберман П.Е., Луговский А.В., Шарафатдинов А.А. // ФТТ. 2010. Т. 37. С. 1995.
- [8] Зюзин А.М., Бажанов А.Г. // Письма в ЖЭТФ. 1996. Т. 63. В. 7. С. 528.
- [9] Hoekstra B., van Stapele R.P., Robertson J.M. // J. Appl. Phys. 1977. V. 48. N 1. P. 382.
- [10] Гуревич А.Г., Мелков Г.А. Магнитные колебания и волны. М.: Физматлит, 1994. С. 464.